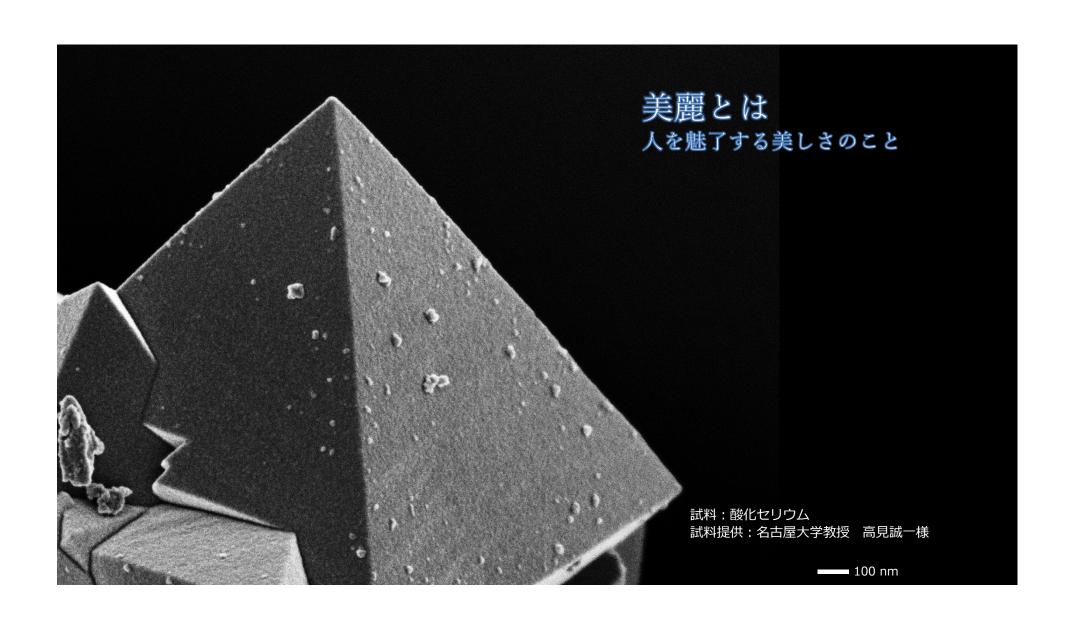


美麗な像が未来をつくる

~JSM-IT800〈SHL〉の各検出器による情報選択~

日本電子株式会社

山口 祐樹



目次

JEOL

- 1. JSM-IT800〈SHL〉の検出システム
- 2. 各検出器による応用例
- SED(二次電子検出器)
- BED(反射電子検出器)
- UHD(上方ハイブリッド検出器)
- UED(上方電子検出器)
- 3. まとめ



JSM-IT800〈SHL〉の検出システム



JSM-IT800〈SHL〉の検出システム



UHD(上方ハイブリッド検出器)

対物レンズの中に設置されている。
二次電子を検出し、試料の表面構造を観察。

SHL(スーパーハイブリッドレンズ)

STD (スタンダード) モード

磁場レンズのみのアウトレンズ型対物レンズ

SHL(スーパーハイブリッドレンズ)モード

磁場レンズと静電レンズによる電磁場重畳型 の対物レンズ

BED(反射電子検出器)

対物レンズの直下に設置されている。 中低角度の反射電子を検出し、組成像・凹凸像・チャネリングコントラストを取得。

UED(上方電子検出器)

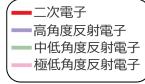
対物レンズの上方に設置されている。 高角度反射電子を検出し、組成像を取得。

磁場レンズ

静電レンズ

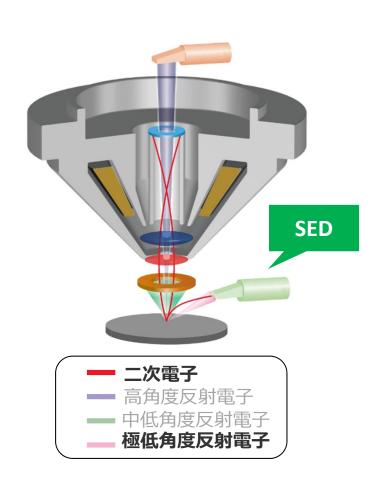
SED(二次電子検出器)

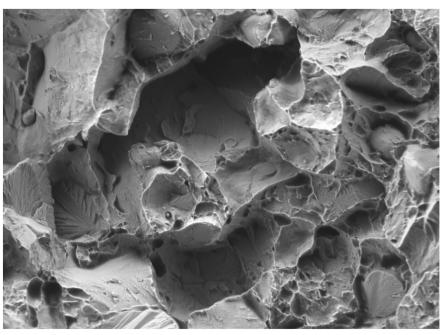
対物レンズの後方に設置されている。 二次電子と極低角度の反射電子を検出し、 試料の凹凸構造を観察。



SED(二次電子検出器)





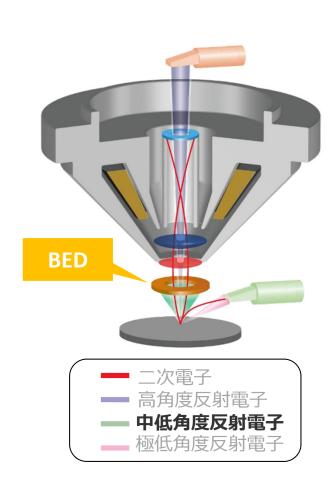


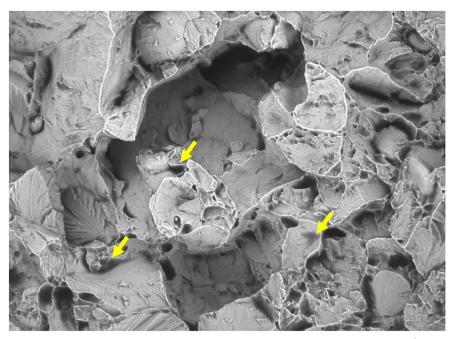
—— 1µm

試料の凹凸構造を観察することができる。

BED(反射電子検出器)





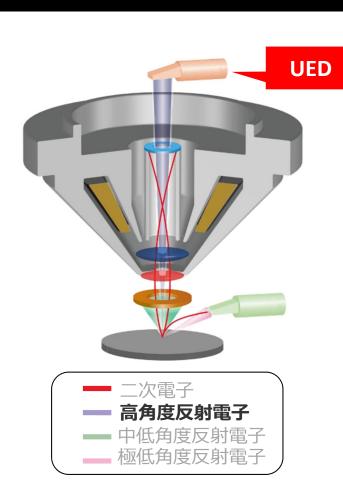


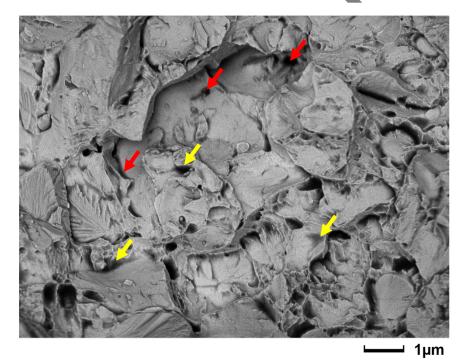
--- 1μm

組成コントラストを観察することができる。

UED(上方電子検出器)



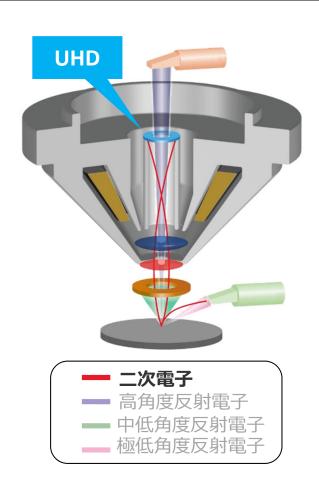


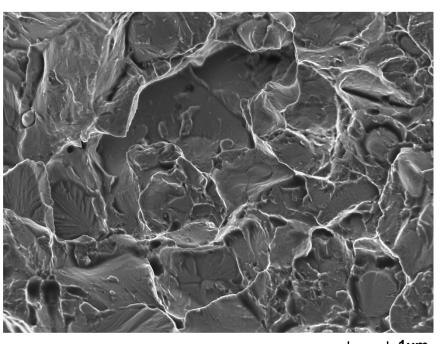


凹凸による影の影響が少なく、 組成コントラストを観察することができる。

UHD(上方ハイブリッド検出器)





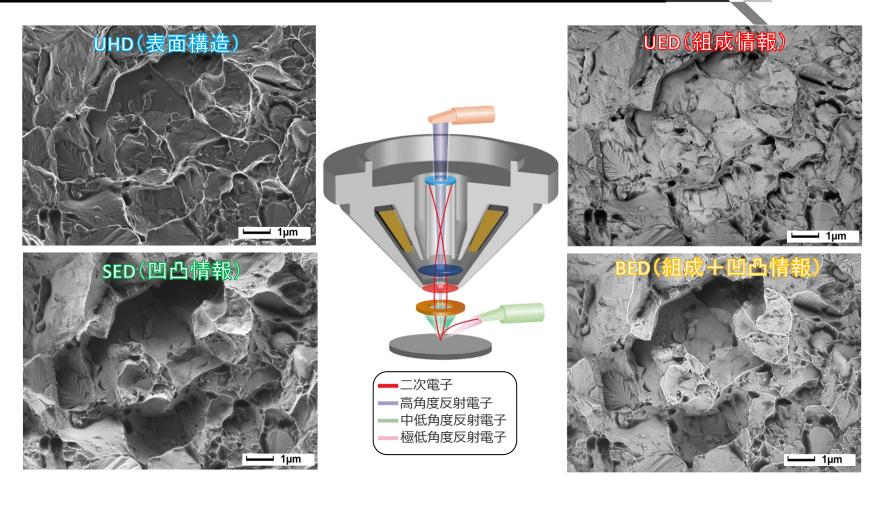


____ 1µm

凹凸による影の影響が少なく、 試料の表面構造を観察することができる。

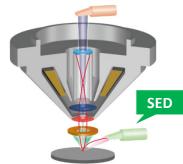
各検出器で取得できる像の違い





SED (二次電子検出器) の応用例

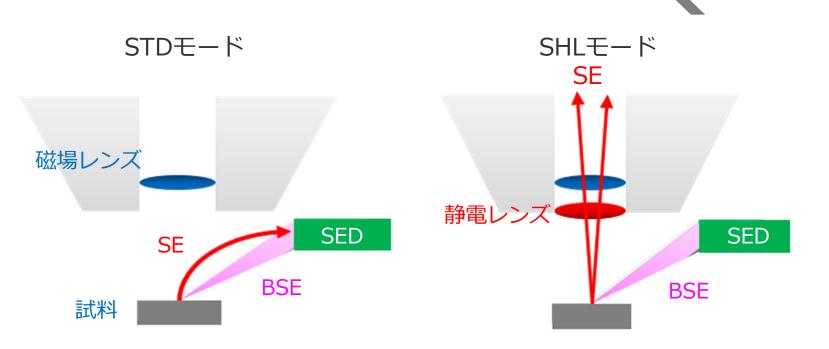






STD/SHLモードでのSED検出の違い

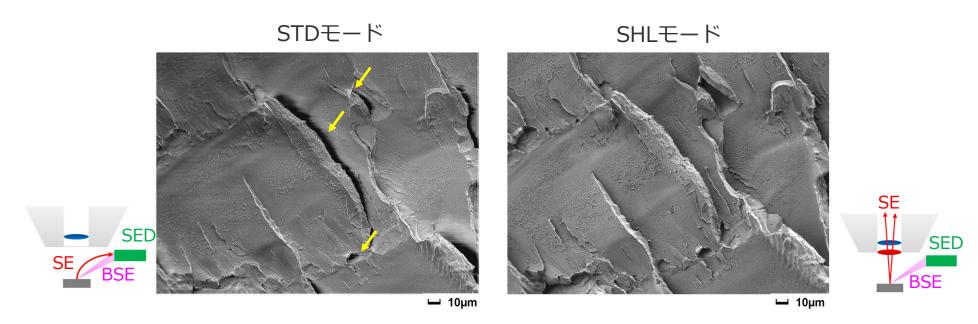




SHLモードにすると、二次電子(SE)が対物レンズ内に取り込まれ、 極低角度の反射電子(BSE)がメインに検出される。

SHL/STDモードでのSED像の違い 試料:樹脂



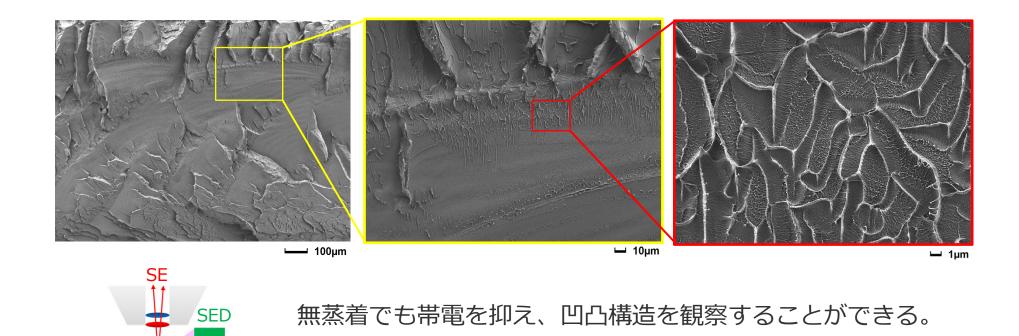


STDモードでは帯電の影響が見えてしまうが、 SHLモードでは帯電の影響を抑え、凹凸構造を観察できる。

試料:樹脂破断面(無蒸着),入射電圧:1.0 kV,倍率 x500, STD/SHLモード

SHLモードでのSED観察例 試料:樹脂

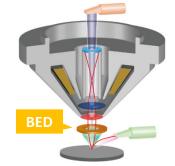




試料:樹脂破断面(無蒸着),入射電圧:1.0 kV, SHLモード

BED (反射電子検出器) の応用例

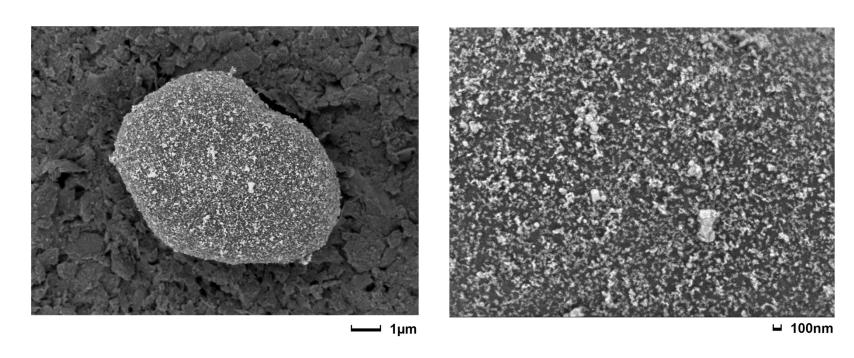
- ◆ 通常の半導体型反射電子検出器(BED)
- ◆ シンチレータ反射電子検出器(SBED)
- ◆ 多目的反射電子検出器(VBED)





SBED(シンチレーター反射電子検出器) 試料:トナー



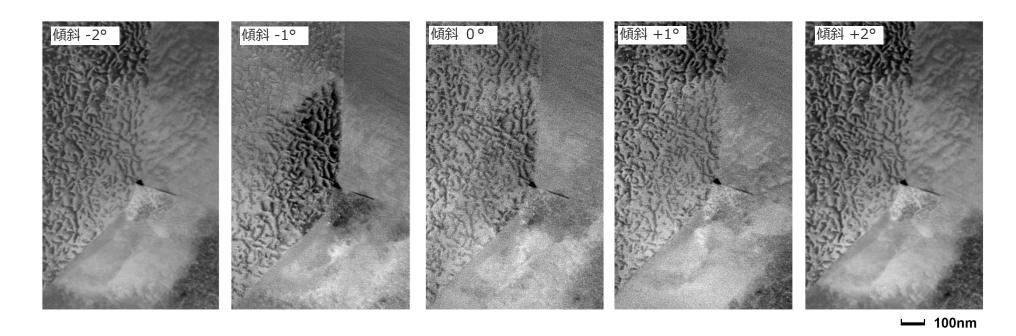


帯電しやすいトナー表面の組成像を低入射電圧で観察

試料:トナー,入射電圧 1.5 kV, 倍率 x10,000, x30,000, STDモード

SBED(シンチレーター反射電子検出器) 試料:鋼板





高入射電圧でチャネリングコントラストや転位像を観察

試料:鋼板(イオンミリング断面),入射電圧 25 kV,倍率 x80,000,STDモード

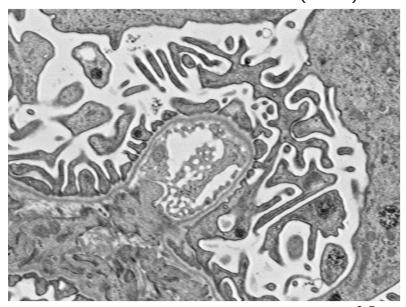
SBED(シンチレーター反射電子検出器) 試料:生物切片



シンチレーター反射電子検出器 (SBED)



半導体型反射電子検出器 (BED)



─ 0.5µm

─ 0.5µm

高速スキャンで観察することが可能。

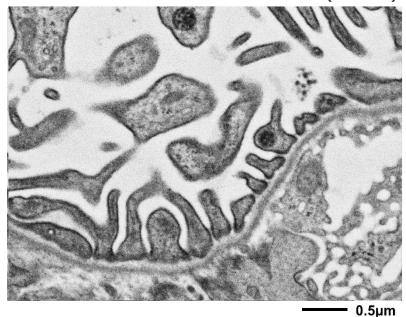
(5120 x 3840 画素で取得, スキャン速度 5.1 sec/frame)

試料:マウス腎臓の超薄切片(コントラスト反転),入射電圧 5.0 kV, 倍率 x15,000, STDモード

SBED(シンチレーター反射電子検出器) 試料:生物切片



シンチレーター反射電子検出器 (SBED)



半導体型反射電子検出器 (BED)

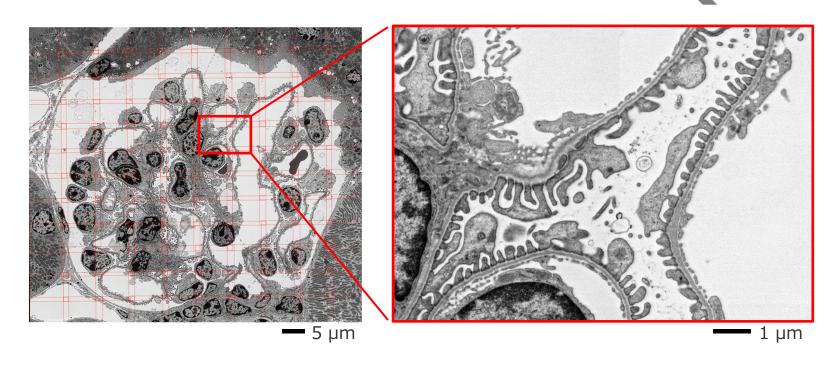


SBEDでは応答性の遅れがなく、像の滲みが無い。

試料:マウス腎臓の超薄切片(コントラスト反転),入射電圧 5.0 kV, 倍率 x15,000, STDモード

SBED(シンチレーター反射電子検出器) 試料:生物切片





高速スキャンにより、120視野のモンタージュ撮影のスループットを向上

試料:マウス腎臓の超薄切片(コントラスト反転), モンタージュソフトウェア: SEMサポーター(システムインフロンティア社製) 単視野の観察条件:入射電圧 5.0 kV, 倍率 x15,000, 5120 x 3840 画素で取得, スキャン速度 5.1 sec/frame, 全視野取得時間: 55 分

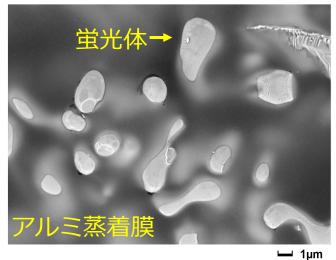
VBED(多目的反射電子検出器) 試料:蛍光体



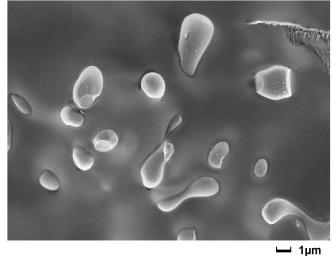
内側素子 (組成情報強調)







外側素子 (凹凸情報強調)





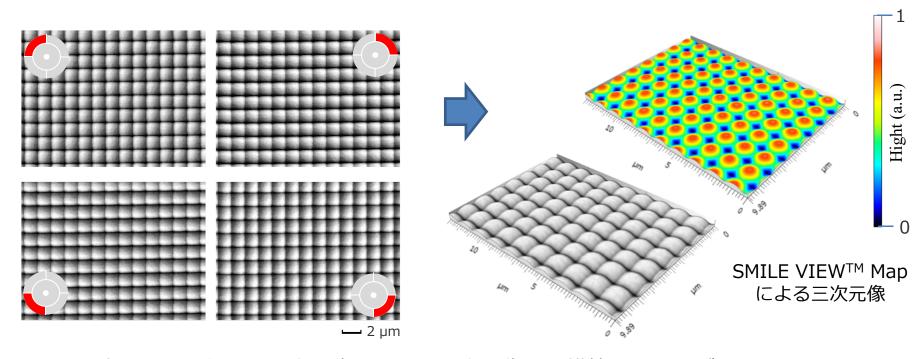


分割された素子によりBSEの放出角度を選別できる。 内側の素子では組成情報が強調され、外側の素子では凹凸情報が強調される。

試料: 蛍光体, 入射電圧 3.0 kV, 倍率 x6,000, STDモード

VBED(多目的反射電子検出器) 試料:CCD素子

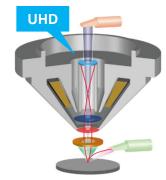




4方向から取得した二次元像を用いて三次元像を再構築することができる。

試料: CCD素子のオンチップマイクロレンズ、入射電圧: 7.0 kV, 倍率 x7,000, STDモード

UHD(上方ハイブリッド検出器)の応用例





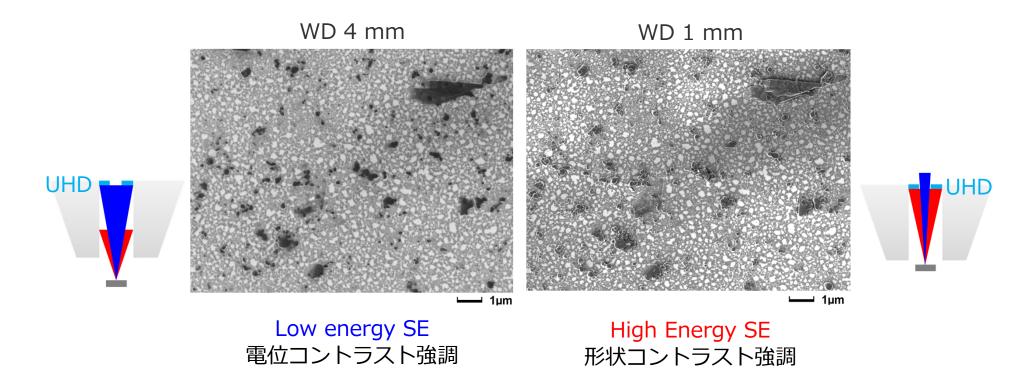
WDの変化によるUHD検出の違い JEOL WD 1 mm WD 4 mm Low energy SE UHD Low energy SE High energy SE High energy SE WD 試料 Low energy SE High energy SE 電位情報 形状情報 BSE 帯電の影響 大 帯電の影響 小

Electron energy

 E_0

WDの変化によるUHD像の違い 試料:窒化ホウ素

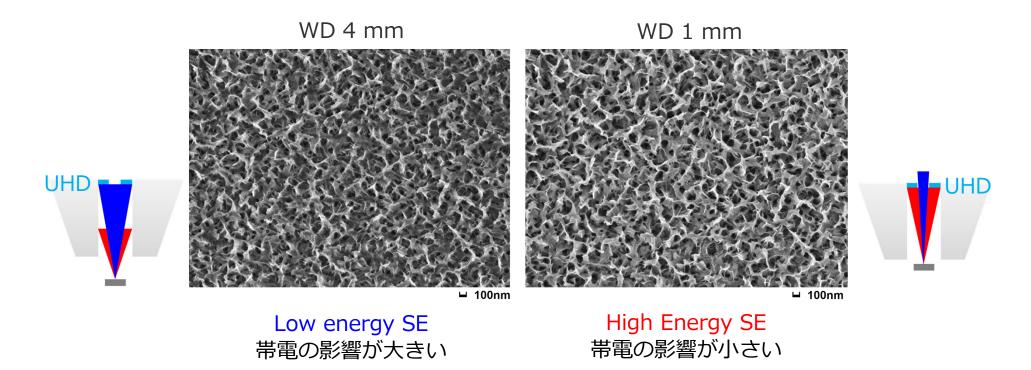




試料:窒化ホウ素,入射電圧: 0.7 kV,倍率 x10,000, SHLモード

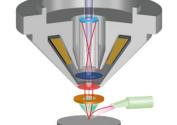
WDの変化によるUHD像の違い 試料:ベーマイト





試料:ベーマイト,入射電圧 0.8 kV,倍率 x30,000, SHLモード

UED (上方電子検出器) の応用例

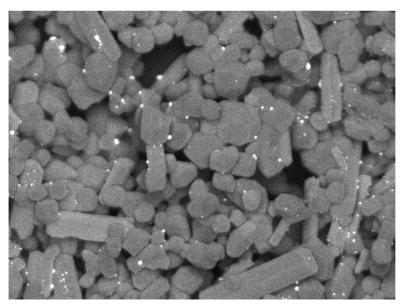


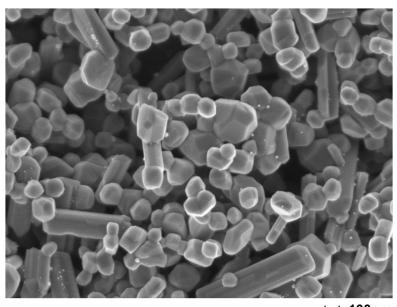
UED



UEDによる反射電子組成像 試料:酸化チタン上の銀ナノ粒子

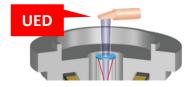




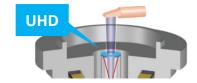


─ 100nm

─ 100nm



同じ視野において UEDでは高角度反射電子による組成像 UHDでは二次電子による表面構造の観察が可能。



試料:酸化チタン上の銀ナノ粒子,入射電圧: 2.0 kV,倍率 x50,000, SHLモード

まとめ



まとめ



SED(二次電子検出器)

- 試料の凹凸構造を観察。
- SHLモードにすると、 SEの検出量が減少し、極低角度の BSEの検出量が増加する。
- 帯電しやすい試料の凹凸像の観察に有効。

BED(反射電子検出器)

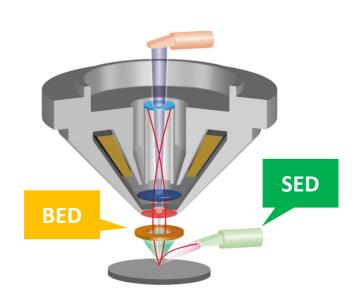
組成像・凹凸像・チャネリングコントラストを観察。

SBED

- 低入射電圧での組成像の観察。
- 高入射電圧でのチャネリングコントラストや転位像の観察。
- 高速スキャンでモンタージュ撮影のスループットを向上。

VBED

- 分割された素子により、BSEの放出角度を選別し、組成情報や凹凸情報を選別。
- 4方向から取得した二次元の凹凸像を用いて、立体的な三次元像を再構築。





UHD(上方ハイブリッド検出器)

- 凹凸による影の影響が少なく、試料の表面構造を観察。
- WDを長くすると、Low energy SEの検出量が増加し、試料表面の電位コントラストが強調される。
- WDを短くすると、High energy SEの検出量が増加し、形 状コントラストが強調される。また、帯電を抑えて構造を 明瞭に観察できる。

UED(上方電子検出器)

- 高角度に放出されたBSEを取得することが可能。
- 凹凸による影の影響が少なく、組成コントラストを観察。

